

(в [7] было принято $E_0^{\text{temp}} = E_F$). Как видно из рис. 2, разница между E_F^* и E_0^{opt} в $\text{PbS}\langle\text{Tl}\rangle$ оказалась существенно большей, чем в теллуриде свинца, легированном таллием [1], и достигала 100 мэВ. Полученный результат согласуется с предположением [1] о таллии как о центре с отрицательной корреляционной энергией.

Не останавливаясь на обсуждении механизмов, приводящих к возникновению в халькогенидах свинца, легированных таллием, центров с отрицательной корреляционной энергией (альтернативные модели предложены в [8, 9]), отметим, что в рамках обсуждаемого предположения находят простое объяснение существенные различия между E_F^* и E_0^{opt} , жесткая стабилизация энергии Ферми в $\text{PbTe}\langle\text{Tl}\rangle$ полосами, ширина которых достигает $5k_0T$ [10], наблюдаемая в $\text{PbTe}\langle\text{Tl}\rangle$ аномальная зависимость ширины полос, связанных с таллием, Γ_0 от концентрации введенной примеси (рис. 1), а также отсутствие сигнала ЭПР [1].

Л и т е р а т у р а

- [1] Вейс А. Н., Кайданов В. И., Крупицкая Р. Ю. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 2. С. 349—352.
- [2] Кайданов В. И., Равич Ю. И. // УФН. 1985. Т. 145. В. 1. С. 51—86.
- [3] Вейс А. Н., Кайданов В. И., Немов С. А. // ФТП. 1980. Т. 14. В. 6. С. 1054—1058.
- [4] Вейс А. Н., Крупицкая Р. Ю., Лумер А. В. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 8. С. 1514—1516.
- [5] Вейс А. Н., Кайданов В. И., Крупицкая Р. Ю., Мельник Р. Б., Немов С. А. // ФТП. 1980. Т. 14. В. 12. С. 2349—2356.
- [6] Вейс А. Н., Прокофьева Л. В. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 4. С. 743—746.
- [7] Кайданов В. И., Мельник Р. Б., Немов С. А. // ФТП. 1979. Т. 13. В. 5. С. 1011—1014.
- [8] Волков Б. А., Тугушев В. В. // Письма ЖЭТФ. 1987. Т. 46. В. 5. С. 193—196.
- [9] Драбкин И. А., Мойжес Б. Я. // ФТП. 1981. Т. 15. В. 4. С. 625—648.
- [10] Кайданов В. И., Немов С. А., Равич Ю. И., Зайцев А. М. // ФТП. 1983. Т. 17. В. 9. С. 1613—1617.

Ленинградский политехнический институт
им. М. И. Калинина

Получено 2.07.1988
Принято к печати 26.07.1988

ФТП, том 23, вып. 1, 1989

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА В РАСПЛАВАХ АНТИМОНИДОВ ГАЛЛИЯ И ИНДИЯ

Глазов В. М., Ким С. Г., Сулейменов Т.

Анализ температурной зависимости вязкости и плотности расплавов антимонидов галлия и индия с привлечением теории активированного комплекса и уравнения Бачинского [1] показал, что процесс радикальной перестройки структуры у этих веществ не завершается в процессе фазового перехода кристалл—расплав при температуре плавления, а продолжается на некотором интервале температур при нагревании расплава. Это явление получило название «послеплавления». Результаты исследований температурной зависимости скорости распространения ультразвука и адиабатической сжимаемости подтверждают наличие явления послеплавления у данных веществ [2].

В деле дальнейшего накопления фактического материала об этом интересном явлении и для более углубленного его понимания представляет интерес исследование поглощения энергии упругих волн в рассматриваемых расплавах.

Трудности экспериментального плана пока не позволяли ставить такую задачу. Поэтому нами были предварительно проведены работы по созданию надежной методики измерения и апробированию ее на примере расплава германия, которые достаточно подробно описаны в [3]. Для решения задачи, поставленной

в настоящей работе, были синтезированы методом ампульного синтеза соединения GaSb и InSb.

Для синтеза соответствующих соединений использовались галлий марки ГА-000, индий Ин-000 и сурьма Су-000. В качестве материала для ампул использовали плавленый кварц. Измерения по методике [3] проводились при несущей частоте импульсов ультразвука $f=52$ МГц в атмосфере высокочистого аргона. На рис. 1 представлены результаты исследований поглощения ультразвука в расплаве GaSb вместе с данными [2] по скорости распространения ультразвука (v_s). Видно, что полтерма коэффициента поглощения, нормированного на квадрат несущей частоты (α/f^2) вблизи температуры плавления, убывает с температурой и, лишь пройдя через явно выраженный минимум, растет при дальнейшем нагреве. Следует заметить, что у жидкых металлов обычно величина α/f^2 монотонно возрастает с нагревом, начиная от точки плавления [3, 4]. Таким образом, «металлический» характер полтермы α/f^2 для расплавов GaSb и InSb приобретает в расплаве антимонида галлия.

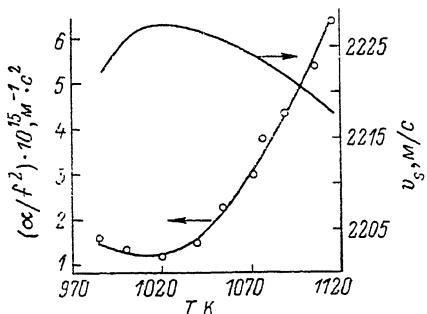


Рис. 1. Температурные зависимости коэффициента поглощения и скорости распространения ультразвука в расплаве антимонида галлия.

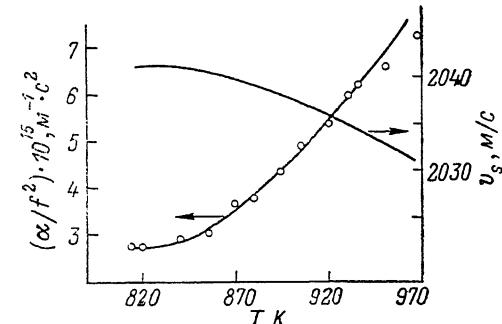


Рис. 2. Температурные зависимости коэффициента поглощения и скорости распространения ультразвука в расплаве антимонида индия.

тают после определенного перегрева. По-видимому, до этой температуры в расплаве происходят структурные изменения, отличающиеся от обычного теплового разрыхления, свойственного жидким металлам.

Интересно отметить, что в этом же интервале температур особым образом ведет себя и полтерма скорости распространения ультразвука. Полтермы α/f^2 и v_s антибатны по отношению друг к другу.

В целом, как видно из сравнения данных, представленных на рис. 1 и 2, качественные картины для антимонидов галлия и индия аналогичны и коррелируют с картиной, наблюдавшейся для расплава германия [3]. Однако минимум поглощения звука в расплаве антимонида индия выражен слабее, чем в случае антимонида галлия, что, по-видимому, отражает и менее выраженные структурные изменения, связанные с явлением послеплавления. Это коррелирует с другими данными, иллюстрирующими это явление [5].

Анализировать полученные результаты можно, основываясь на двухструктурной модели расплава, впервые примененной Гитисом и Михайловым [6] по отношению к жидкой сурьме и получившей дальнейшее развитие и уточнение как двухструктурная кластерная модель расплава в работе [7].

В соответствии с этой моделью расплав вблизи температуры плавления можно представить как суперпозицию атомарной матрицы с преимущественно металлическим типом межатомной связи и кластерных образований, химическая связь между атомами в которых реализуется преимущественно по ковалентному типу. Очевидно, при нагревании происходят разукрупнение кластеров и одновременно уменьшение их содержания в общем объеме расплава. Оба эти процессы могут привести к уменьшению поглощения ультразвуковых волн вследствие уменьшения доли энергии упругой волны, отбираемой внутренними, в частности колебательными, степенями свободы в кластерах.

Таким образом, исследования поглощения энергии упругих волн успешно дополняют исследования других структурно-чувствительных свойств в деле изучения явления послеплавления в расплавах полуметаллов и полупроводников.

Л и т е р а т у р а

- [1] Глазов В. М., Чижевская С. Н., Глаголева Н. Н. Жидкие полупроводники. М., 1967. 244 с.
- [2] Регель А. Р., Глазов В. М., Ким С. Г. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 8. С. 1353—1376.
- [3] Глазов В. М., Ким С. Г., Сулейменов Т. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 11. С. 1943—1947.
- [4] Гитис М. Б., Михайлов И. Г., Нязов С. // Акуст. ж. 1968. Т. 14. В. 1. С. 57—61.
- [5] Регель А. Р., Глазов В. М. Закономерности формирования структуры электронных расплавов. М.: 1982. 320 с.
- [6] Гитис М. Б., Михайлов И. Г. // Акуст. ж. 1966. Т. 12. В. 2. С. 145—159.
- [7] Глазов В. М., Ким С. Г. // ТВТ. 1987. Т. 25. В. 5. С. 900—907.

Московский институт электронной техники

Получено 22.07.1988
Принято к печати 28.07.1988

ФТП, том 23, вып. 1, 1989

ПОВЕРХНОСТНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОНОВ В МДП СТРУКТУРАХ ИЗ $Cd_xHg_{1-x}Te$ *p*-ТИПА

Пономаренко В. П., Салмин Е. А., Стafeев В. И., Шиманский И. В.

Поверхностная подвижность неосновных носителей в твердых растворах теллуридов кадмия—ртути практически не исследована. Опубликовано всего несколько сообщений, где приводятся лишь значения эффективной поверхностной подвижности электронов в МДП структурах из *p*-КРТ при температуре жидкого азота [^{1—4}].

В настоящей работе приведены результаты исследования подвижности в приповерхностном инверсионном канале МДП структур на основе $p\text{-}Cd_xHg_{1-x}\text{Te}$ с $x \approx 0.3$.

Эффективная поверхностная подвижность электронов μ_s^* вычислялась из измерений удельной крутизны g^* полевых *n*-канальных МДП или МТДП транзисторов [^{5, 6}] на линейном участке выходных характеристик по формуле [⁷]

$$\mu_s^* = L g^*/Z C_s, \quad (1)$$

где L — длина затвора транзистора, Z — его ширина, C_s — удельная емкость диэлектрика МДП структуры затвора.

Значения поперечного электрического поля в приповерхностной области полупроводника E_s вычислялись из уравнений [⁷]

$$\epsilon_s E_s = \epsilon_i E_x, \quad (2)$$

$$E_x = (U_G - U_{FB} - \varphi_s)/d_s, \quad (3)$$

из которых

$$E_s = \frac{\epsilon_i}{d_s \epsilon_s} (U_G - U_{FB} - \varphi_{inv}), \quad (4)$$

где ϵ_s , ϵ_i — диэлектрические проницаемости КРТ и подзатворного диэлектрика, E_x — поперечное электрическое поле в диэлектрике, U_G — напряжение на затворе МДП структуры, U_{FB} — напряжение плоских зон, равное -0.7 В, φ_s — поверхностный потенциал, d_s — толщина диэлектрика, φ_{inv} — потенциал инверсии. В области глубокой инверсии поверхностный потенциал не зависит от U_G и $\varphi_s = \varphi_{inv}$.

Транзисторы были изготовлены на подложках *p*-КРТ с концентрацией дырок $p_0 = (3 \div 8) \cdot 10^{15}$ см⁻³ и подвижностью $\mu_p = 400 \div 500$ см²/В·с при 77 К. В МДП транзисторах в качестве стока и истока использовались *n*⁺—*p*-переходы, полученные ионной имплантацией Be⁺. Сток и исток в МТДП транзисторах представляли собой диоды Шоттки с промежуточным туннельно-прозрачным слоем